

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于采购ASML XT 1900 Gi型光刻机的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司购买光刻机设备概况

2020年8月13日上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十四次会议审议通过《关于转让全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司股权暨关联交易的议案》，公司与上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）、上海超成材料科技有限公司（以下简称“超成科技”）签署了《增资及股权转让协议》。增资及股权转让完成后，公司持有芯刻微 38%的股权，超成科技持有芯刻微 62%的股权，芯刻微公司未来进行ArF湿法光刻胶的研发。

集成电路制造用 ArF 湿法光刻胶产品技术要求高、投资需求大，公司为加速集成电路制造用高端光刻胶全品类的国产化进程，减少上市公司业绩压力，通过参股子公司芯刻微进行 ArF 湿法光刻胶的研发，并与协议各方承诺未来通过向上市公司进行股权转让或技术转让等方式避免可能的同业竞争。详见公司 2020 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于股权转让暨关联交易公告》。

近日，由芯刻微公司委托盛吉盛（宁波）半导体材料有限公司（以下简称“盛吉盛”）代理投标，成功中标，购得 ASML XT 1900 Gi 型二手光刻机一台，该设备可用于研发分辨率达 28nm 的高端光刻胶。3 月 11 日，芯刻微公司向盛吉盛支付 10%首期货款购入该光刻机，剩余 90%六个月内付清。后续公司将启动设备的运输及相关安装调试等工作。

二、购买该设备对公司的影响及风险

1.公司作为国内集成电路制造关键工艺材料供应商，自立项进行光刻胶项目研发以来，将突破集成电路高端光刻胶国外垄断，实现集成电路高端光刻胶材料

的国产化作为发展目标，在 ArF 干法、KrF 厚膜及 I 线光刻胶方面已有技术与产品的突破。通过子公司芯刻微开展的 ArF 湿法光刻胶项目研发也已引进了核心技术专家团队，为 ArF 湿法光刻胶项目的开发提供了技术保障，现公司采购的 ASML 浸没式光刻机设备是对公司 ArF 湿法光刻胶技术先进性的设备保障，对加快公司集成电路制造用光刻胶产品研发项目进度有积极影响，有利于进一步提升公司光刻胶产品的核心竞争力，加速落实公司发展战略，提高公司抗风险能力和可持续发展能力。

2.本次购买的光刻机尚须经过运输、装机、调试及投入相关配套设施，若以上环节出现工作疏漏或失误则存在造成所购买的光刻机投入使用的过程较长甚至无法投入使用的风险。

3.光刻胶产品在集成电路材料中技术难度大，质量要求最高，开发周期长，且核心技术及原材料几乎被国外厂商所垄断。因此，存在着研发失败和研发计划滞后的风险。

敬请投资者注意投资风险。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021年3月11日